

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成 17 年 6 月 23 日 (2005.6.23)

【公開番号】特開 2002-212786 (P2002-212786A)

【公開日】平成 14 年 7 月 31 日 (2002.7.31)

【出願番号】特願 2001-9537 (P2001-9537)

【国際特許分類第 7 版】

C 2 5 D 7/12

C 2 5 D 3/38

C 2 5 D 17/06

C 2 5 D 17/08

C 2 5 D 19/00

H 0 1 L 21/288

【F I】

C 2 5 D 7/12

C 2 5 D 3/38

C 2 5 D 17/06 C

C 2 5 D 17/08 B

C 2 5 D 17/08 M

C 2 5 D 19/00 B

H 0 1 L 21/288 E

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 10 月 6 日 (2004.10.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板を保持するヘッド部と、前記基板に対して所定の処理を行う複数の基板処理部とを備え、

前記ヘッド部は、基板を保持したまま、前記基板処理部間を移動して各基板処理部において前記所定の処理を行うことを特徴とする基板処理装置。

【請求項 2】

前記複数の基板処理部のうちの少なくとも 1 つは、基板に対してめっき処理を行うめっき処理部であることを特徴とする請求項 1 に記載の基板処理装置。

【請求項 3】

前記複数の基板処理部のうちの少なくとも 1 つは、基板を洗浄する洗浄部であることを特徴とする請求項 1 に記載の基板処理装置。

【請求項 4】

前記洗浄部は、洗浄後の基板を乾燥するエアブローを備えたことを特徴とする請求項 3 に記載の基板処理装置。

【請求項 5】

前記ヘッド部は、保持した基板を傾動可能に支持する傾動機構を備えたことを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか一項に記載の基板処理装置。

【請求項 6】

前記ヘッド部は、該ヘッド部を傾動させることによって、保持した基板を水平面に対し

傾斜させた状態で液面に接触させる傾動機構を備えたことを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか一項に記載の基板処理装置。